PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05167143 A

(43) Date of publication of application: 02.07.93

(51) Int. CI

H01S 3/043 H01S 3/18

(21) Application number: 03353920

(22) Date of filing: 19.12.91

(71) Applicant:

NIPPON STEEL CORP

(72) Inventor:

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

IMAI HIROFUMI YAMAGUCHI SATORU

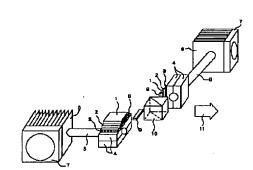
TAMAGOCIII GATON

(54) SEMICONDUCTOR LASER EQUIPMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor laser equipment in which a cooler attached to a light emitting unit thereof can be reduced in size by a safe and simple method and a plurality of light emitting units thereof can be disposed near at hand.

CONSTITUTION: An array semiconductor laser 1 having an optical output 10W is used as a semiconductor laser, mounted at a temperature control Peltier element 3 for controlling a temperature of the laser 1 through a copper spacer 2, integrally disposed on a copper heat block 4, the block 4 is fixed to one side end of a heat pipe 5, a radiating fin 6 is mounted at the other, and forcibly air-cooled by an air cooling fan 7, thereby obtaining an excellent operation of the laser 1. After emitted lights from the two lasers 1 disposed near a light emitting unit 8 are collimated by a collimator lens 9, and polarized planes are disposed to match the input port of a polarized wave combining polarizing beam splitter 10 to obtain a polarized wave combining optical output 11.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平5-167143

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51)lnt.CL ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
HOIS	3/043					
	3/18		9170-4M			
			8934-4M	HOIS	3/ 04	S

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

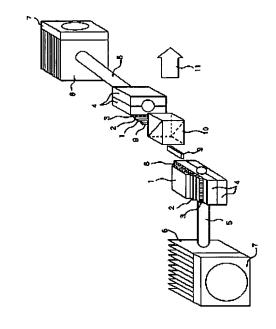
(21)出顯番号	特顯平3-353920	(71)出題人 000006655	000006655	
		新日本製鐵株式会社		
(22)出顧日	平成 3 年(1991)12月19日	東京都千代田区大手町2丁目6番3	号	
		(72)発明者 今井 浩文		
		神奈川県相模原市淵野辺 5 ー10ー し	神奈川県相模原市淵野辺 5 - 10 - 1 新日本製鐵株式会社エレクトロニクス研究所内	
		本製鐵株式会社エレクトロニクス研		
		(72)発明者 山口 哲		
		神奈川県相模原市綱野辺 5 -10-1	神奈川県相模原市綱野辺5-10-1 新日	
		本製鐵株式会社エレクトロニクス研	充所内	
		(74)代理人 弁理士 田北 鴬晴		

(54)【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【目的】 半導体レーザの発光部に付随する冷却部を安全かつ簡便な方法にて小型化し、複数の半導体レーザの発光部を近接して配置することが出来る半導体レーザ装置とする。

【様成】 半導体レーザとして光出力10 Wのアレイ半 導体レーザ1を用い、これを銅のスペーサー2を介して 半導体レーザ1の温度制御用ペルチエ素子3 に取り付け けったれらを一体として銅のヒートブロック4上に配置したのヒートブロック4をヒートバイブ5の片方の端に固定し、他端に放熱フィン6を取り付け、空冷ファン7 により強制空冷し、アレイ半導体レーザ1の良好な動作を得る。発光部8を近接して配置した2台のアレイ半導体レーザ1からの出射光をコリメーティングレンズ9でコリメートした後、各々の偏波面を偏波台成用偏光ビームスプリッター10の入力ポートに合わせて配置し、 偏波合成光出力11を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザからの発熱あるいは半導体 レーザを温度制御するための電子冷却素子からの発熱を 除去するためのヒートパイプを備えることを特徴とする 半導体レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光エネルギー源として 半導体レーザを用いる応用分野(例えば、固体レーザ励 起やレーザマイクロプロセッシングなど) に関するもの 10 である。

[0002]

【従来の技術】狭い活性層に電流を注入する半導体レー ザの光/電気変換効率は非常に高く、中には50%を越 えるものもある。しかし、残りの50%は熱に変わるの であり、これを局所的発熱という観点からみると非常に 大きなものになっていることがわかる。近年、発展著し い高出力型の半導体レーザを例にとれば、活性層幅20 0μm、長さ300μm、光出力1W、光/電気変換効 率31)%の半導体レーザでは、3.9 k W/c m¹ とな 20 る。これは、なんらかの強制的冷却を行わない限り、半 導体の溶融による破壊を招く。このため、ペルチエ素子 による電子冷却や空冷などが広く行われている(例え ば、1991 PRODUCT CATALOG p56:SPECTRA DIOCE LABS等 参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の半導 体レーザ装置は、ヒートシンク等の抜熱部が半導体レー ザの発光部と一体型になっているため。一つの半導体レ ーザの発光部が占める体積が大きく、複数の半導体レー 30 ザの発光部を近接して配置し、偏波合成などの技術によ り複数の半導体レーザのパワーを一つの光エネルギー源 として集積化を図ることが難しい。これでは、本来、小 型、高効率、高出力である半導体レーザの特質を十分に 活かすことが出来ない。一方、水冷は、半導体レーザか ちの発熱を一旦水を介して移動させ、他の場所に設置し た放熱器によって最終的に放熱する点で、上記課題を解 決し得るものであるが、万一、半導体レーザ側で水もれ を起こした場合、致命的である。また、配管や循環ポン プなどを必要とするため、装置全体が複雑になり、必然 的に大型になってしまう。

【0004】本発明は、かかる状況に鑑みてなされたも ので、半導体レーザの発光部に付随する冷却部を安全か つ簡便な方法にて小型化し、複数の半導体レーザの発光 部を近接して配置することが出来る半導体レーザ装置を 提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、この発明の手段として、半導体レーザ装置におい 度制御するための電子冷却素子からの発熱を除去するた めのヒートパイプを備えるものである。

[0006]

【作用】本発明では、半導体レーザあるいは半導体レー ザを温度制御するための電子冷却素子からの発熱をヒー トパイプによって除去する。ヒートパイプとは、銅など の熱伝導性の良い金属の中空パイプ中に水あるいはフロ ンの蒸気を低気圧で封入したものである。ヒートバイプ の一方の端に発熱体、他方の端にフィンなどの放熱器を 取り付けると、発熱体側で熱せられた蒸気が高速で放熱 器側に移動し 放熱器で熱を奪われて液体となる。ヒー トバイプの傾斜等によりとの液体が再び発熱体側に戻る ようにしておけば、このサイクルが繰り返される。かく して、蒸気を介して発熱体から放熱器へ熱が移動するの である。

【0007】ヒートバイブは円筒状であるので、発熱源 であるところの半導体レーザパッケージあるいは電子冷 却素子をヒートバイプに取り付けるためのヒートプロッ クを通して熱がヒートパイプに伝えられるようにする必 要がある。ヒートブロックは、熱伝導性のよい銅などで 作成する。片側の形状は半導体レーザバッケージあるい は電子冷却素子の形状に合わせて加工し、他方はヒート パイプの形状に合わせて円筒状にくり抜く。これらを組 み合わせる際には、隙間にシリコングリスや銀ペースト など熱伝導性のよい充填衬を充填する。ヒートバイプの 他端には、放熱用のフィンやフィンを強制空冷するため のファン、あるいは場合により水冷器等を取り付ける。 このようにして、半導体レーザの発光部に付随する冷却 部を実質的に小型化することができる。

[0008]

【実施例】本発明の特徴と利点を一層明らかにするた め、以下、実施例に基づいて詳細に説明する。

温度制御するための電子冷却素子からの発熱をヒートバ イブを用いて除去する半導体レーザ装置を2台使用して 偏波合成を行った実施例の模式図である。図1に示すご とく、半導体レーザとして、一つの活性層が幅100 # m. 長さ250 μmのものが20個1次元的にならべち れた、光出力10℃のアレイ半導体レーザ1を用い、こ れを固定のための銅のスペーサー2を介して半導体レー ザの温度制御を行う電子冷却素子として用いるベルチエ 素子3に取り付けた。これらを一体として、銅のヒート プロック4に取り付け、ヒートプロック4をヒートパイ プ5の片方の端に固定した。ヒートパイプ5として直径 16 mm、長さ250 mmの銅製のものを用いた。これ は1台の半導体レーザの発熱量とこれを温度制御するた めのベルチェ素子からの発熱量を合わせた熱量を除去で きるヒートパイプでできるだけ小型のものという観点か ら選択したものであるが、この点を満たすものであれば て、半導体レーザからの発熱あるいは半導体レーザを温 50 上記の寸法でなくてもよい。個々の物の間の境界面には

熱伝導性のシリコングリスを塗った。ヒートパイプ5の 他方の端には放熱用のフィン6を取り付け、空冷ファン 7により強制空冷を行った。アレイ半導体レーザ1から の発熱及びアレイ半導体レーザ1の温度制御のためのペ ルチエ素子3からの発熱は、ヒートパイプ5を介して放 熱フィン6へ良好に熱伝達され、アレイ半導体レーザ1 は良好に動作した。アレイ半導体レーザ1の発光部8に 対して、ヒートプロック4までを含めた大きさは実質的 に十分コンパクトであり、このようにコンパクトな冷却 部を備えて初めて図 1 に示すような2 台のアレイ半導体 10 レーザ1の発光部8を近接させた構成が可能となった。 すなわち、2台のアレイ半導体レーザ1をそれぞれコリ メーティングレンズ9でコリメートした後、各々の偏波 面を偏波合成のために用いる偏光ビームスプリッター1 ()の2つの入力ボートの内1つに合うように配置した。 これにより2台の10型アレイ半導体レーザ1から出 射したレーザ光は完全に同軸に合わせられ、合成された 光出力11として18型が得られた。これをさらに集光 レンズで集光することにより強力な光電磁界を得ること ができる。また、半導体レーザの波長を変えて、ダイク ロイックミラーを用いれば、ますます高密度に光パワー を集積していくことができる。

3

【0010】なお、本発明の実施例においては、LDの 温度制御のため、ペルチエ素子を用いたが、温度制御が 不要な場合には、LDを直接ヒートブロックに取り付け ればよい。また、スペーサー、ヒートブロックとして銅* * 製のものを用いたが、他の熱伝導性のよい材質のもので もよい。

[0011]

【発明の効果】冷却機構としてかかる構成を持つ半導体レーザ装置は、半導体レーザの発光部に付随する冷却部を小型化し、複数の半導体レーザの発光部を近接して配置することを可能とし、ハイパワーレーザとしての半導体レーザの利用を重工業、半導体産業、医療など様々な産業分野において促進するものである。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】半導体レーザ及び半導体レーザを温度制御する ための電子冷却素子からの発熱をヒートパイプを用いて 除去する半導体レーザ装置を2台使用して偏波合成を行った実施例の模式図である。

【符号の説明】

- 1 アレイ半導体レーザ
- 2 銅スペーサー
- 3 ベルチエ素子
- 4 ヒートブロック
- 20 5 ヒートパイプ
- 6 熱フィン
 - 7 空冷ファン
 - 8 アレイ半導体レーザ発光部
 - 9 コリメーティングレンズ
 - 10 偏光ビームスプリッター
 - 11 台成光出力

[21]

